



ご案内

半導体専門 実践講座 説明会

主催：広島大学大学院先端物質科学研究科
(協力:半導体関連産業製造中核人材育成コンソーシアム)

後援：中国地域産学官コラボレーションセンター

趣旨：半導体関連産業の技術者養成のための半導体専門実践講座を開設しています。受講希望者のための模擬授業を提供し、受講方法の説明を行います。多数ご参加ください。

日時：平成 22年 4月 23日 (金)
13時 ~ 17時 20分

会場：広島大学東千田総合校舎 A棟 2階 206講義室
(広島市中区東千田町 1-1-89)

対象：半導体関連企業の経営者、人材教育担当者の方
教育関係者、興味のある方

定員：80名 (参加無料)

プログラム

13:00 挨拶・概要説明 『半導体専門実践講座とは』 横山 新

開講日程、受講方法等について

13:15 - 13:20 開講スケジュール、受講方法、費用等

模擬授業

13:20 - 14:00 『IC設計作成評価基礎及び集積システム序論』 田中 武

14:00 - 14:20 『プリント基板の低電磁雑音設計』 五百旗頭 健吾

14:20 - 15:00 『集積システム開発 (メカトロシステム)』 三枝 省三
(休憩) デモンストレーション

15:15 - 15:35 『デジタル上位設計・設計検証手法』 弘中 哲夫

15:35 - 16:05 『アナログ・RF回路の設計と測定』 岩田 穆

16:05 - 16:25 『半導体製造プロセスにおける分析・評価技術』 村上 秀樹

16:25 - 16:55 『デバイスプロセス』 横山 新

質問・要望

16:55 - 17:20 質問・要望など



LSI・マイコンからロボットまで

開設科目のご案内

全13科目開講。各科目は半分以上が実習であり座学と実習の組み合わせにより、学習の意欲が向上します。

- 半導体専門実践講座には養成する人材のタイプ、LSI製造技術者、LSI設計技術者、LSI応用システム開発技術者に対応して、科目Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを組み合わせる3つのコースを用意しており、修了者には認定証を授与します。●

【科目Ⅰ】LSIプロセス・デバイス

- ・ LSI製造要素プロセス基礎編
- ・ LSI製造プロセス応用編
- ・ 半導体製造プロセスにおける分析・評価技術
- ・ IC設計作成評価基礎 <広島工業大学で開講>

【科目Ⅱ】LSI設計

- ・ デジタル上位設計・設計検証手法 <広島市立大学で開講>
- ・ 高速デジタルインタフェース設計
- ・ アナログ回路の設計
- ・ アナログ回路の測定
- ・ RF回路の設計と測定

【科目Ⅲ】LSI応用システム

- ・ 集積システム序論 <広島工業大学で開講>
- ・ 集積システム開発（メカトロシステム）
- ・ 先端複合実装技術
- ・ プリント基板の低電磁雑音設計

【参画団体】

広島大学、岡山大学、広島市立大学、広島工業大学
エルピーダメモリ(株)、シャープ(株)LSI事業本部、
(株)トッパン・テクニカル・デザインセンター、
ローツェ(株)、(株)エイアールテック

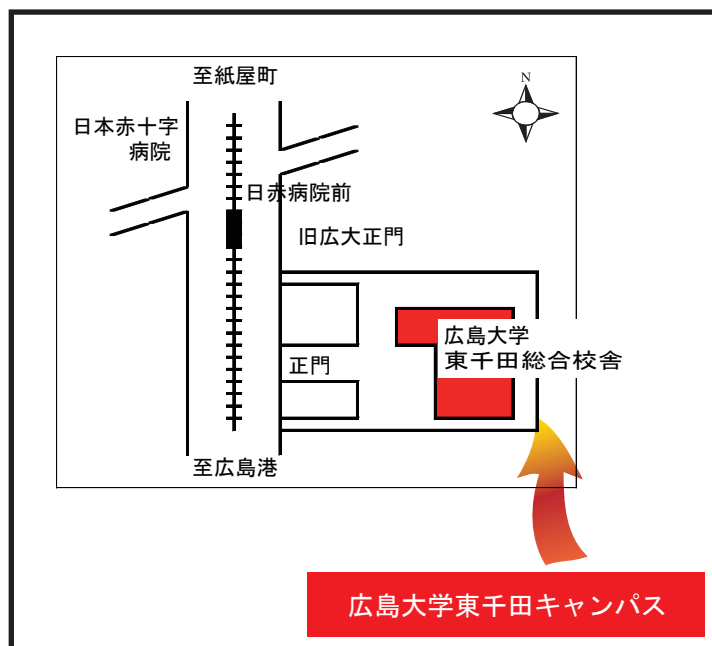
お問合せ先・参加申込書

FAX: 082-424-7000

E-mail: tchprosm@hiroshima-u.ac.jp



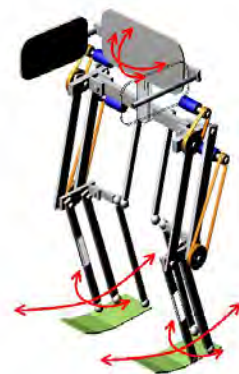
会場案内図



アクセス

JR広島駅 又は
広島バスセンター（紙屋町）から
市内電車 紙屋町経由
広島港（宇品）行（1番）
日赤病院前下車
広島駅から約30分
バスセンターから約15分

歩行支援 ロボット



- 詳細掲示 ホームページ：
<http://www.hiroshima-u.ac.jp/adsm/>

ふりがな
氏名

所属

連絡先 住所・Tel :

e-mail :

* 個人情報の取り扱いについて、広島大学の規則に基づき十分注意を払い取り扱います。

当日直接会場にお越しください。ただし、準備の都合もありますのでなるべく事前にお申込みください。メールでのお申込みでも結構です。